

©1994 г.

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ПЕРЕНОС ГОРЯЧИХ ЭЛЕКТРОНОВ В КВАНТОВЫХ ПРОВОЛОКАХ С РАССЕЯНИЕМ НА ПОЛЯРНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ФОНОНАХ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

B.M. Осадчий

Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук, 630090, Новосибирск, Россия
(Получена 6 декабря 1993 г. Принята к печати 11 января 1994 г.)

Процессы переноса электронов в квантовых проволоках отличаются от объемных вследствие наличия сингулярностей в плотности состояний [1]. В последнее время стационарный перенос в проволоках из GaAs изучался теоретически в ряде работ (см. [2–5]). Работы по исследованию установления стационарного состояния практически отсутствуют, исключая [5–7]. В [5, 6] рассматривалась динамика дрейфовой скорости, в [7] — условия для удержания или убегания электронов в проволоке. В данной работе мы исследуем эволюцию электронной функции распределения в квантовых проволоках из GaAs и InAs, отличающихся величиной интенсивности электрон-фононного взаимодействия. Для исследования применяется многочастичный метод Монте-Карло. Используется модель, включающая одну энергетическую подзону и рассеяние только на полярных оптических фононах с вероятностью рассеяния из работы [1]. Температура берется настолько низкая, что рассеяние на акустических фононах и поглощение оптических фононов пренебрежимо мало.

Результаты расчета показали, что динамика функции распределения различна в проволоках из GaAs и InAs и существенно отличается от объемной [8]. На рис. 1 показана временная эволюция функции распределения электронов в импульсном пространстве в проволоке из InAs. Начальная функция дельтообразная и на рисунке не показана. Вначале электроны движутся баллистически, а при достижении энергии оптического фонона включаются процессы испускания. В проволоках включение испускания фононов происходит резко и отсутствует угловая разориентация импульса, поэтому после первого рассеяния появляются два хорошо разделяющихся пика (рис. 1, a), что не происходит в объемном материале [8]. Левый (правый) пик соответствует

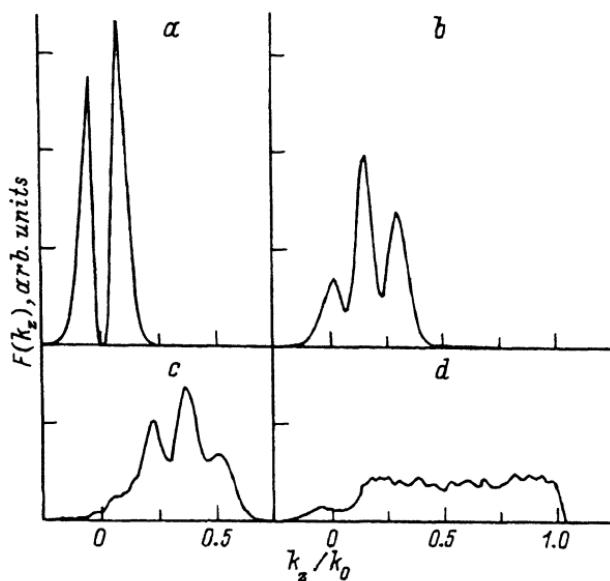


Рис. 1. Функция распределения электронов в квантовой проволоке из InAs размером $10 \times 10 \text{ нм}^2$ при температуре 4.2 К в моменты времени, пс: а — 9, б — 19, с — 29, д — 600 после включения электрического поля 100 В/см. k_0 — импульс электрона с энергией оптического фона.

электронам, рассеявшимся «назад» («вперед»). После второго рассеяния каждый из пиков производит еще два, но два из образовавшихся четырех пиков сливаются (рис. 1, б). Эти пики могут выжить после нескольких рассеяний, рис. 1, с представляет функцию распределения после третьего рассеяния. После пятого рассеяния максимумы полностью сливаются. Таким образом, функция распределения в проволоке из InAs может иметь несколько пиков в течение времени около 40 пс. Стационарная функция распределения имеет форму в виде плато (рис. 1, д), тогда как в объеме эта функция острая [8]. Электронный

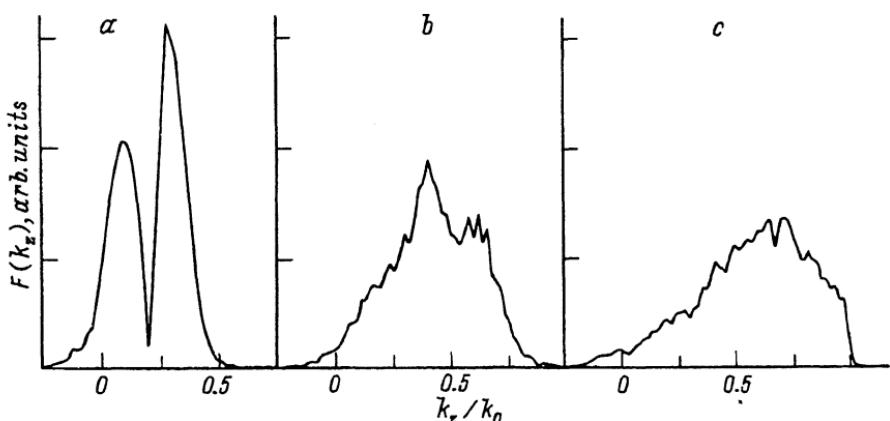


Рис. 2. Функция распределения электронов в квантовой проволоке из GaAs размером $10 \times 10 \text{ нм}^2$ при температуре 4.2 К в моменты времени, пс: а — 4, б — 8, с — 12 после включения электрического поля 500 В/см.

ансамбль в объемном InAs достигает стационарного состояния примерно за 50 пс, а в проволоке за $500 \div 600$ пс.

Такая эволюция функции распределения проявляется в том, что отклик дрейфовой скорости в проволоке, так же как и в объеме, имеет характер затухающих колебаний, возникающих вследствие чередования баллистического движения электронов и испускания фононов. В проволоке эти осцилляции выражены лучше и существуют гораздо дольше, чем в объеме, вследствие упомянутых особенностей процессов рассеяния [5,9].

Характер нестационарного переноса зависит от интенсивности рассеяния. В GaAs интенсивность рассеяния выше, чем в InAs, и эволюция функции менее интересна. После первого рассеяния два пика разделены меньше, так как электроны проникают на меньшую глубину в область энергии выше энергии фона (рис. 2,a). Эти пики плохо различаются уже после второго рассеяния (рис. 2,b). Электроны в объемном GaAs достигают стационарного состояния за время около 10 пс, а в проволоке за $40 \div 50$ пс.

Качественно вид эволюции функции распределения сохраняется и при температуре 77 К для узкого начального распределения. Такая ситуация может быть реализована как при фотоинжекции в проволоку электронов, так и для наблюдения абсолютной отрицательной проводимости [6].

Таким образом, мы продемонстрировали, что в проволоках из InAs неравновесная функция распределения электронов в импульсном пространстве имеет хорошо разделенные пики, которые могут выжить после нескольких рассеяний. В проволоках из GaAs таких особенностей функции распределения нет из-за более интенсивного электрон-фононного взаимодействия.

Автор признателен А.В. Ефанову за обсуждение полученных результатов. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Список литературы

- [1] J.P. Leburton. *J. Appl. Phys.*, **56**, 2850 (1984).
- [2] D. Chattopadhyay, A. Bhattacharyay. *Phys. Rev. B*, **37**, 7105 (1988).
- [3] S. Briggs, J.P. Leburton. *Phys. Rev. B*, **38**, 8163 (1988).
- [4] J.P. Leburton. *Phys. Rev. B*, **45**, 11022 (1992).
- [5] J.P. Leburton, D. Jovanovic. *Sem. Sci. Techn.*, **7**, B202 (1992).
- [6] R. Mickevicius, V. Mitin, M.A. Stroscio, M. Dutta. *J. Phys.: Condens. Matter.*, **5**, 2233 (1993).
- [7] T. Yamada, J. Sone. *Phys. Rev. B*, **40**, 6265 (1989).
- [8] A. Matulionis, J. Pozela, A. Reklaitis. *Phys. St. Sol. (a)*, **31**, 83 (1975).
- [9] V.M. Osadchy. In: *Nanostructures: Physics and Technology. Int. Symp. Abstracts. St. Petersburg* (1993).

Редактор Т.А. Полянская